

F20

薄膜分析仪

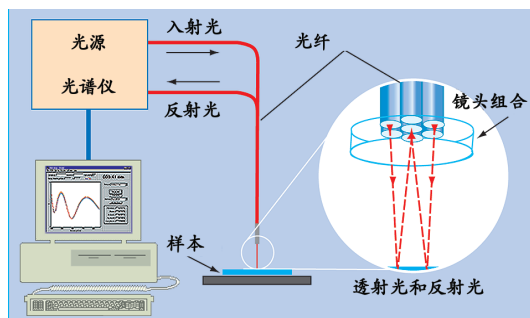


免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

Filmetrics优势

- 内置自动波长校准
- 包括独立软件
- 能储存历史记录并复制、绘制测量结果



最具有价格优势的先进薄膜测量系统

使用F20高级频谱反射测量系统，我们能轻松的实现对膜层厚度和光学常数(n和k值)的测量。通过对膜层顶部、底部反射光谱进行分析，数秒内我们即可得到膜层的厚度、折射率和消光系数。

通过内置的独立软件和USB接口，能够很容易的把F20安装在任何的Windows电脑平台上。健全的软件材料库(100多种材料)，极大的满足了对各种不同膜层结构测量的需要，包括对单层、多层或独立膜层的测量。透过测量样品的光学常数或导入已存在的资讯，能够在材料库内快速的新增新材料。

可测样品膜层

基本上所有光滑的、半透明的或低吸收系数的薄膜都可以测量。主要包括电介质与半导体材料，例如：

二氧化硅	氮化硅	类金刚石镀膜
光刻胶	聚合物膜层	聚酰亚胺
多晶硅	非晶硅	硅

相关应用

半导体制造

- 光刻胶
- 氧化物
- 氮化物

光学镀膜

- 硬涂层
- 抗反射涂层
- 滤波片

液晶显示器

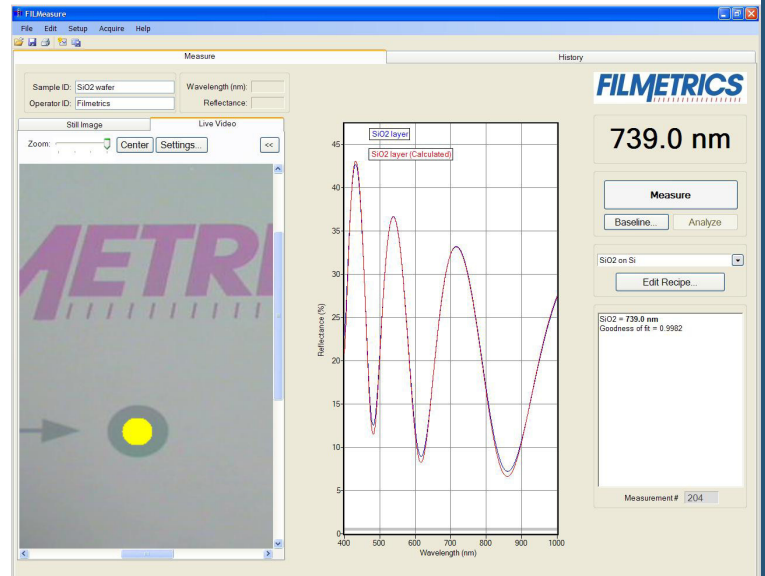
- 盒厚
- 聚酰亚胺
- 导电透明膜

生物医学

- 聚对二甲苯
- 生物膜厚度
- 硝化纤维

F20

薄膜分析仪



具有SampleCam影像功能的FILMeasure™软件界面。

	F20-UV	F20	F20-NIR	F20-EXR	F20-UVX	F20-XT
测量范围*:	1纳米-40微米	15纳米-100微米	100纳米-250微米	15纳米-250微米	1纳米-250微米	10微米-1毫米
测量n和k值的厚度要求*:	50纳米以上	100纳米以上	300纳米以上	100纳米以上	50纳米以上	-
准确度*:	0.4%或2纳米之间较大者(F20-UV为1纳米, F20-XT为5纳米)					
精度 ¹ :	0.1纳米		0.2纳米	0.1纳米		1纳米
稳定性 ² :	0.07纳米		0.12纳米	0.07纳米		1纳米
斑点尺寸:	标准1.5毫米, 最小可选至20微米				2.0毫米	600微米
样品尺寸:	直径从1毫米到300毫米					
光源:	氙光灯或钨卤素灯	钨卤素灯			氙光灯或钨卤素灯	钨卤素灯
光谱仪						
波长范围:	200-1100纳米	380-1050纳米	950-1700纳米	380-1700纳米	200-1700纳米	1440-1690纳米

提供定制化的波长组合。

* 取决于材料。

¹ 标准偏差为一天内在Si基底上对厚度为500纳米的SiO₂薄膜样品连续测量100次所得厚度值的标准偏差。该值为连续20天测量的标准偏差值的平均值。

² 2σ是基于连续20天, 每天在基底上对厚度为500纳米的SiO₂薄膜样品连续测量100次所得厚度值上得出。

基本要求	
电源:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.3-0.1 A
电脑要求	
操作系统:	Windows XP-SP2-Windows 8 (64-bit)
系统内存:	至少 50 MB
硬盘空间:	至少 60 MB
界面:	USB 2.0
互联网:	建议联网以便网上支持
认证:	CE EMC和欧洲安全指令

FILMETRICS

Filmetrics, Inc.
3560 Dunhill St., Ste. 100
San Diego, CA 92121
Tel: +886-6-505-5180
http://cn.filmetrics.com

内容如有更改, 恕不另行通知。
©2013 Filmetrics, Inc. Rev. 4.13
Printed in the USA